

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 2 部門第 4 区分  
【発行日】平成 16 年 10 月 7 日 (2004.10.7)

【公開番号】特開 2001-96900 (P2001-96900A)  
【公開日】平成 13 年 4 月 10 日 (2001.4.10)  
【出願番号】特願 平 11-275821

【国際特許分類第 7 版】

B 4 1 M 5/00

B 0 5 D 5/04

B 0 5 D 7/04

B 0 5 D 7/24

B 4 1 J 2/01

【F I】

B 4 1 M 5/00 B

B 0 5 D 5/04

B 0 5 D 7/04

B 0 5 D 7/24 3 0 2 B

B 4 1 J 3/04 1 0 1 Y

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 9 月 22 日 (2003.9.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

透明支持体上に気相法シリカを含有するインク受容層を塗布し乾燥するインクジェット記録材料の製造方法において、塗布されたインク受容層を 20 以下の雰囲気下で冷却した後乾燥することを特徴とするインクジェット記録材料の製造方法。

【請求項 2】

前記乾燥するときの空気の温度が 60 以下である請求項 1 に記載のインクジェット記録材料の製造方法。